ij



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月15日

出願番号

Application Number:

特願2001-006635

[ ST.10/C ]:

[JP2001-006635]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2002年 1月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



### 特2001-006635

【書類名】

特許願

【整理番号】

J0081955

【提出日】

平成13年 1月15日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 1/00

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

小林 幸久

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

【連絡先】

0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】

須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013044

【納付金額】

21,000円

# 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路基板およびその製造方法ならびに表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 はんだ接続によって実装されたはんだ接続部品と、異方性導電膜を介して実装された導電膜接続部品とを備える回路基板であって、

前記はんだ接続部品が実装されたはんだ接続部品実装領域と、

前記導電膜接続部品が実装された導電膜接続部品実装領域と、

前記導電膜接続部品実装領域を含んで帯状に延び、かつ前記はんだ接続部品が実装されない帯状領域と、

を有する回路基板。

【請求項2】 請求項1において、

前記はんだ接続部品は受動素子または機構部品であり、前記導電膜接続部品は 半導体装置である回路基板。

【請求項3】 請求項1または請求項2において、

前記帯状領域は、前記導電膜接続部品を実装する際に用いられる加熱圧着治具 のヘッドの端面より幅が広い回路基板。

【請求項4】 前記帯状領域の側縁部にアラインメントマークが設けられている回路基板。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の回路基板と、表示部とを有する表示装置。

【請求項6】 はんだ接続部品をはんだ接続によって基板に実装する工程と

前記基板上の所定位置に異方性導電膜を配置する工程と、

導電膜接続部品を前記異方性導電膜上に配置する工程と、

前記異方性導電膜を挟んで前記導電膜接続部品を前記基板に熱圧着する工程と

を有する回路基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、回路基板およびその製造方法ならびに表示装置に関する。

[0002]

【背景技術および発明が解決しようとする課題】

はんだ接続部品を効率的に実装して回路基板を製作するために、はんだペーストが印刷されはんだ接続部品が配置された回路基板をリフロー炉に通すことによってはんだ接続を行う表面実装技術(Surface Mount Technology)が一般的に用いられている。表面実装技術においては、はんだを溶融させるためのリフロー炉内において、回路基板全体が高温例えば260℃になってしまう。

[0003]

また、ICチップなどは益々高集積化が進み、それらの基板への実装においても少ない占有面積で実装が可能なフリップチップボンディングが多くなっている。フリップチップボンディングにおける接合方式としては、異方性導電膜を使用する方式が主要な方式の一つである。ところで、異方性導電膜を用いた実装においては、樹脂に導電粒子を分布させて形成された異方性導電膜を挟んで、バンプを備えたICチップなどを、バンプに対向する電極を備える基板に熱圧着する必要がある。この熱圧着には、ICチップの幅に対応する幅を持ちICチップの長さを越えて細長く形成されたヘッドを備えた熱圧着治具を使用することが多い。このように長いヘッドを持つ熱圧着治具は、基板上に実装された部品がヘッドと干渉して熱圧着が不適切となってしまうのを避けるために、ICチップの周囲特にICチップの長さ方向における周囲にはんだ接続部品が実装されてない状態で使用する必要がある。

[0004]

そこで、異方性導電膜を用いたICチップなどの実装の後に、表面実装技術によるはんだ接続部品の実装を実施することが考えられる。ところが、前述したように、表面実装技術では回路基板全体を高温のリフロー炉に通す必要があり、このプロセスによって異方性導電膜による接続信頼性の低下が起こりうることが確認されている。

[0005]

本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであって、その目的は、異方性導電膜による接続の信頼性を低下させることなくはんだ接続部品を表面実装技術によって実装して形成できる回路基板およびその製造方法ならびにその回路基板を用いた表示装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

(1) 本発明に係る回路基板は、はんだ接続によって実装されたはんだ接続 部品と、異方性導電膜を介して実装された導電膜接続部品とを備える回路基板で あって、

前記はんだ接続部品が実装されたはんだ接続部品実装領域と、

前記導電膜接続部品が実装された導電膜接続部品実装領域と、

前記導電膜接続部品実装領域を含んで帯状に延び、かつ前記はんだ接続部品が 実装されない帯状領域と、を有することを特徴としている。

[0007]

本発明によれば、導電膜接続部品実装領域を含んで帯状に延びる帯状領域に、はんだ接続部品が実装されないため、はんだ接続部品を実装した後に導電膜接続部品を実装して形成することが可能な回路基板が得られる。したがって、例えば表面実装技術における熱が異方性導電膜に加わることが回避できる。その結果、この回路基板は、異方性導電膜による接続の信頼性を低下させることなく、はんだ接続部品を表面実装技術によって実装して形成することが可能である。

[0008]

(2) 本発明に係る回路基板は、前記はんだ接続部品が受動素子または機構 部品であり、前記導電膜接続部品が半導体装置であることを特徴としている。

[0009]

本発明によれば、半導体装置の異方性導電膜による接続の信頼性を低下させることなく、受動素子または機構部品を表面実装技術によって実装して形成することが可能である。

[0010]

(3) 本発明に係る回路基板は、前記帯状領域が、前記導電膜接続部品を実

装する際に用いられる加熱圧着治具のヘッドの端面より幅が広いことを特徴としている。

[0011]

本発明によれば、はんだ接続部品を実装した後に導電膜接続部品を実装するために加熱圧着治具を用いる場合でも、加熱圧着治具の接触面がはんだ接続部品と 干渉することなく使用できるため、適切な過熱圧着を行うことができる。

[0012]

(4) 本発明に係る回路基板は、前記帯状領域の側縁部にアラインメントマークが設けられていることを特徴としている。

[0013]

本発明によれば、導電膜実装部品を実装する際に異方性導電膜でアラインメントマークが覆われてしまうことを回避できる。

[0014]

(5) 本発明に係る表示装置は、前記いずれかの回路基板と、表示部とを有することを特徴としている。

[0015]

本発明によれば、高い信頼性で導電膜接続部品が実装された回路基板が用いられた表示装置であるため、信頼性の高い表示装置が得られる。

[0016]

(6) 本発明に係る回路基板の製造方法は、

はんだ接続部品をはんだ接続によって基板に実装する工程と、

前記基板上の所定位置に異方性導電膜を載置する工程と、

導電膜接続部品を前記異方性導電膜上に載置する工程と、

前記異方性導電膜を挟んで前記導電膜接続部品を前記基板に熱圧着する工程と

を有することを特徴としている。

[0017]

本発明によれば、はんだ接続部品が実装された後に、導電膜接続部品を実装して回路基板が製造される。したがって、はんだ接続例えば表面実装技術における

熱が異方性導電膜に加わることが回避できる。その結果、異方性導電膜による接続の信頼性を低下させることなく、はんだ接続部品を表面実装技術などによって 実装できる。

[0018]

### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照しながら、さらに具体的 に説明する。

[0019]

#### 1. 回路基板

図1は、本実施形態に係る回路基板10を示す平面図である。図2は、図1に 示した円Eで囲まれた領域を拡大して示す模式的な平面図である。また、図3は 、部品が実装されてない状態における本実施形態の回路基板10である。

[0020]

本実施形態に係る回路基板10は、基板11と、基板11にはんだ接続されたはんだ接続部品30と、基板11に異方性導電膜40を介して実装された導電膜接続部品36例えばLSIとを備えている。

[0021]

また、図1に対応する平面図として回路基板10の各領域を示す図4に示すように、回路基板10は、はんだ接続部品実装領域14、導電膜接続部品実装領域18、および帯状領域22の各部分を含んで形成されている。なお、図4においては、導電膜接続部品実装領域18の領域としての一例を示しているが、導電膜接続部品実装領域18は帯状領域22内のいずれの位置に形成することもできるし、帯状領域22内に複数形成することもできる。また、帯状領域22も複数形成してもかまわない。さらにまた、帯状領域22は必ずしもはんだ接続部品実装領域14とはんだ接続部品実装領域14との間に形成する必要はなく、回路基板10の一端に形成してもかまわない。

[0022]

はんだ接続部品実装領域14には、抵抗やコンデンサなどの受動素子や、機構 部品などのはんだ接続部品がはんだ接続によって実装されている。

### [0023]

導電膜接続部品実装領域18には、半導体装置すなわちICやLSIなどの導電膜接続部品36が異方性導電膜を挟んで実装されている。

### [0024]

帯状領域22は、導電膜接続部品実装領域18を含む領域であり、帯状に延びている。帯状領域22には、はんだ接続部品30は実装されない。図5は、導電膜接続部品36を実装する際に用いられる加熱圧着治具のヘッド71aの端面が位置する領域(斜線を施した領域)と回路基板10との間の位置関係を平面図として示す図である。この図と図4とを比較すると明らかなように、はんだ接続部品30が実装されていない帯状領域22は、導電膜接続部品36を実装する際に用いられる加熱圧着治具のヘッド71aの端面より幅が広く、また、ヘッド71aの端面と回路基板10とが対向する領域の長さと等しい長さを持つ領域となっている。したがって、はんだ接続部品30を実装した後に導電膜接続部品36を実装するために加熱圧着治具を用いる場合でも、加熱圧着治具のヘッド71aがはんだ接続部品30と干渉することなく使用できるため、適切に加熱圧着して導電膜接続部品36を実装することができる。なお、ヘッド71aの端面の長さが回路基板10の差し渡しの長さより短い場合、帯状領域22は、ヘッド71aの端面と回路基板10が対向する領域の長さ以上の長さを持つ領域となっていればよい。

#### [0025]

また、図2に示したように、回路基板10には、帯状領域22の側縁部にアラインメントマーク23が設けられている。アラインメントマーク23は、導電膜接続部品36として例えばLSIを実装する際に、LSIに設けられたアラインメントマークと所定の位置関係となるようにLSIを位置決めするために用いられる。また、アラインメントマーク23は、帯状領域22の側縁部に設けられているため、LSIなどの導電膜接続部品36を実装する際に導電膜接続部品実装領域18上に配置する異方性導電膜40でアラインメントマーク23が覆われてしまうことを回避できる。また、アラインメントマーク23は熱圧着治具のヘッド71aと対向する領域の外側に形成されているため、ヘッド71aの接触によ

る汚れなどによって認識しづらくなることがない。なお、アライメントマーク23は2つあれば平面での位置決めが可能となるから十分であるが、それ以上あってもかまわない。その場合、製造装置に応じて認識し易いアライメントマークを選択することが可能となる。また、アライメントマークの配置箇所は、位置合わせ箇所に近いほど好ましい。これは、アライメントマークが位置合わせ箇所から離れるにしたがい、基板11の変形に起因する誤差が大きくなるからである。

[0026]

このように、本実施形態の回路基板10は、導電膜接続部品実装領域18を含んで帯状に延びる帯状領域22に、はんだ接続部品30が実装されないため、はんだ接続部品30を実装した後に導電膜接続部品36を実装して形成することが可能である。したがって、例えば表面実装技術における熱が異方性導電膜40に加わることが回避できる。その結果、この回路基板10は、異方性導電膜40による接続の信頼性を低下させることなく、はんだ接続部品30を表面実装技術によって実装して形成することが可能である。

[0027]

## 2. 回路基板の製造方法

本実施形態の回路基板10の製造方法においては、まず、受動部品や機構部品などのはんだ接続部品30を、表面実装技術などを用いてはんだ接続によって基板11に実装する。

[0028]

次に、基板11上の所定位置に異方性導電膜40を配置する。例えば、異方性 導電膜40は図7に模式図として示したように、一方のリール50aから供給さ れて他方のリール50bに巻き取られるように構成されたリールツーリールの方 式で供給される。また、このようにして供給される異方性導電膜40は、図7に おいて一部を拡大して示すように、離型紙42上に位置し、適切な長さで切り目 41が入れられた状態となっている。そして、基板11と異方性導電膜40とを 相対的に近づけ、切り目41の間の区間を押圧治具54などで軽く押圧して基板 11上の所定の位置に配置する。

[0.029]

そして、LSIなどの導電膜接続部品36を基板11上の異方性導電膜40に 配置する。なお、この異方性導電膜40を配置する際に、上記のアライメントマ ーク23を利用してもかまわない。

[0030]

次に、図6に模式的に示したように、熱圧着治具の2つのヘッド71aと71 bで加熱しながら押圧して、異方性導電膜40を挟んで導電膜接続部品36例えばLSIを基板11に熱圧着する。この熱圧着治具のヘッド71aは、図5にも示したように、導電膜接続部品36や異方性導電膜40の長さより遥かに長い領域にわたる形状となっている。しかしながら、熱圧着治具のヘッド71aは、はんだ接続部品30が実装されていない帯状領域22の幅内に位置するため、はんだ接続部品30と接触したりすることがない。なお、基板11を挟んでヘッド71aと反対側にあるヘッド71bの形状については、必ずしもヘッド71aと同一の形状である必要はない。しかし少なくとも、ヘッド71bの端面は導電膜接続部品36の基板11と圧着される面と面積が同一もしくは広いことが必要である。また、導電性接続部品36とヘッド71bの位置関係は、導電性接続部品36の基板11と圧着される面全体がヘッド71bの端面と平面的に重なりあうことも必要である。

[0031]

このように、本実施形態の回路基板10の製造方法においては、受動素子や機構部品などのはんだ接続部品30が実装された後に、LSIなどの導電膜接続部品36を実装して回路基板10が製造される。したがって、はんだ接続工程例えば表面実装技術を用いた工程における熱が異方性導電膜40に加わることが回避できる。その結果、異方性導電膜40による接続の信頼性を低下させることなく、はんだ接続部品30を表面実装技術などによって実装できる。

[0032]

### 3. 表示装置

前述した回路基板10は、表示部例えば液晶パネルを駆動する駆動回路(ドライバ)を含むように形成することができる。ここでは、そのような回路基板10を用いた表示装置としての液晶装置について説明する。

[0033]

図8に斜視図として示すように、表示装置としての液晶装置80は、液晶パネル82に回路基板10を接続することによって形成される。また、必要に応じて、バックライト等といった照明装置やその他の付帯構造が液晶パネル82に付設される。

[0034]

液晶パネル82は、周縁が互いに接着された一対の基板83を有し、それらの基板83間に形成された間隙、いわゆるセルギャップに、例えばSTN (Super Twisted Nematic)型の液晶が封入されて形成されている。基板83は一般には透光性材料、例えばガラス、または合成樹脂によって形成される。

[0035]

また、基板83の外側には偏光板86が貼着され、少なくとも一方の基板83 と偏光板86との間に位相差板(図示せず)が挿入されている。図示しないが、 これら基板83のそれぞれの内側表面には表示用電極が形成されている。これら の表示用電極はストライプ状または文字、数字、その他の適宜のパターン状に形 成される。表示用電極は、例えば、ITO (Indium Tin Oxide: インジウムスズ 酸化物)等といった透光性導電材料によって形成される。

[0036]

液晶パネル82は、一方の基板83が他方の基板83から張り出す張出し部84を有し、その張出し部84に複数の接続端子85が形成されている。これらの接続端子85は、基板83上に表示用電極を形成するときにそれと同時に形成され、例えばITOによって形成される。なお、表示用電極および接続端子85は、実際には極めて狭い間隔で多数本が基板83上に形成される。

[0037]

回路基板10と液晶パネル82との接続は、例えば、液晶パネル82の基板83の張出し部84に異方性導電膜によって回路基板を接続することによって行われる。異方性導電膜は、回路基板10において導電膜接続部品36を基板11に接続するために用いられたものと同様に、接着用樹脂およびそれに混入された導電性粒子によって形成されており、熱圧着することにより、その接着用樹脂によ

って回路基板10と基板83とが固着され、そして、導電性粒子によって回路基板10の各端子26と液晶パネル82の接続端子85とが導電接続される。

[0038]

- 4. 変形例
- 4.1 前述した実施形態においては、回路基板の形状として1つの例のみを示したが、特許請求範囲の記載の範囲内で様々な形状の回路基板とすることができる。

[0039]

4.2 前述した実施形態においては、表示部として液晶パネルを用いた表示装置の例を示したが、表示部は液晶パネルに限らず、CRTディスプレイ、プラズマディスプレイ、FED (Field Emission Display)、ELD (Electronic Luminescence Display) 等であってもよい。

[0040]

4.3 本発明は前述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内、または、特許請求の範囲の均等範囲内で、各種の変形実施が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施形態に係る回路基板を示す平面図である。

【図2】

図1に示した円Eで囲まれた領域を拡大して示す模式的な平面図である。

【図3】

部品が実装されてない状態における回路基板を示す平面図である。

【図4】

図1に対応する平面図として回路基板の各領域を示す図である。

【図5】

導電膜接続部品を実装する際に用いられる加熱圧着治具のヘッドが位置する領域と回路基板との間の位置関係を平面視において示す図である。

【図6】

熱圧着治具の2つのヘッドによって異方性導電膜を挟んで導電膜接続部品を基 板に熱圧着する様子を示す模式的な断面図である。

【図7】

異方性導電膜を基板上の所定位置に配置する様子を示す模式図である。

【図8】

表示装置としての液晶装置を示す斜視図である。

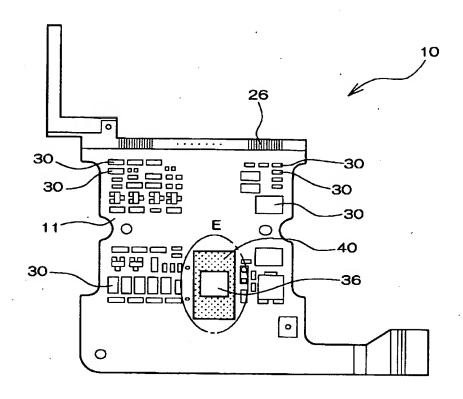
【符号の説明】

- 10 回路基板
- 11 基板
- 14 はんだ接続部品実装領域
- 18 導電膜接続部品実装領域
- 22 帯状領域
- 23 アラインメントマーク
- 30 はんだ接続部品
- 36 導電膜接続部品
- 40 異方性導電膜
- 71a ヘッド
- 80 液晶装置(表示装置)
- 82 液晶パネル (表示部)

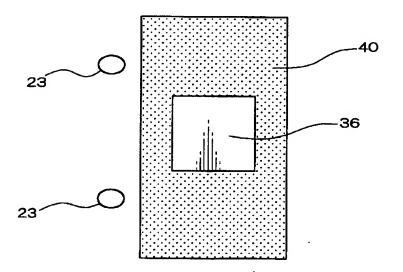
【書類名】

図面

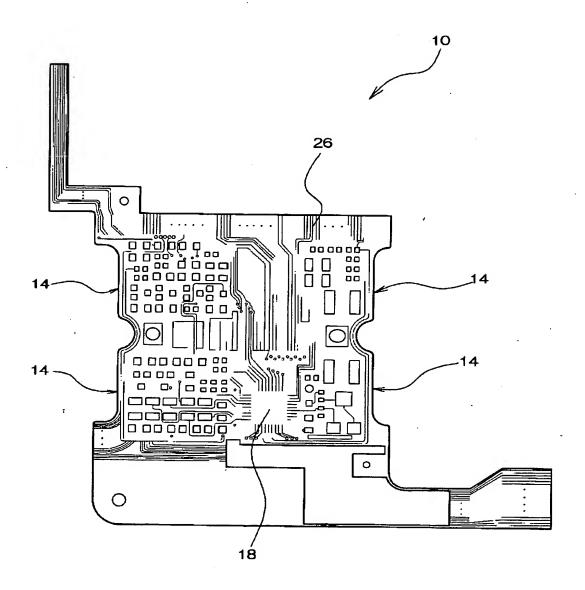
【図1】



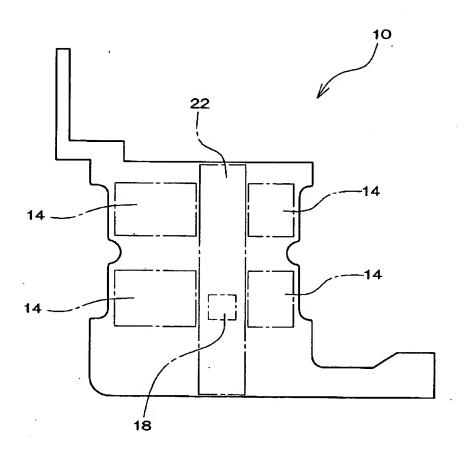
【図2】



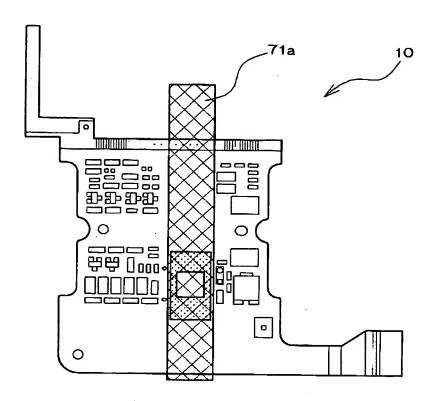
【図3】



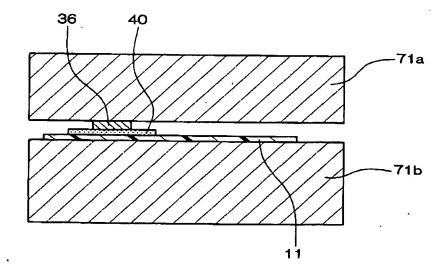
【図4】



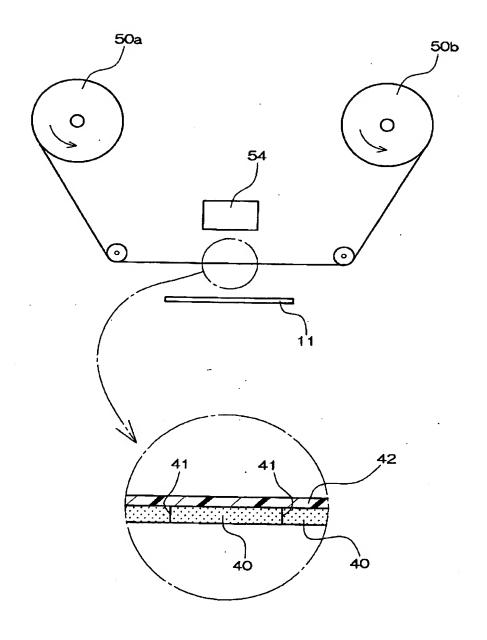
【図5】



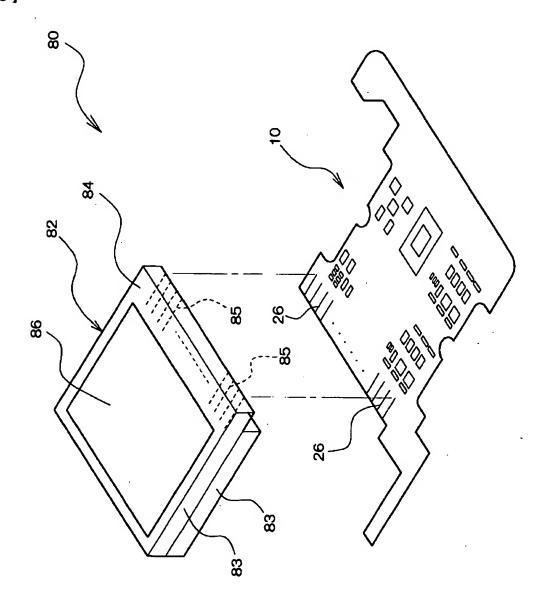
【図6】



【図7】



【図8】



#### 特2001-006635

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 異方性導電膜による接続の信頼性を低下させることなくはんだ接続部品を表面実装技術によって実装して形成できる回路基板を提供する。

【解決手段】 はんだ接続によって実装されたはんだ接続部品と、異方性導電膜を介して実装された導電膜接続部品とを備える回路基板10である。この回路基板10は、はんだ接続部品が実装されたはんだ接続部品実装領域14と、導電膜接続部品が実装された導電膜接続部品実装領域18と、導電膜接続部品実装領域18を含んで帯状に延び、はんだ接続部品14は実装されない帯状領域22とを備えている。帯状領域22は導電膜接続部品を実装する際に用いられる加熱圧着治具のヘッドの端面より幅が広い。

【選択図】 図4

# 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社